【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公表番号】特表2003-525320(P2003-525320A)
【公表日】平成15年8月26日(2003.8.26)
【出願番号】特願2001-560692(P2001-560692)
【国際特許分類】
Ｃ０８Ｆ　6/00　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　33/53　(2006.01)
Ｇ０１Ｎ　33/566　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｆ　6/00
Ｇ０１Ｎ　33/53　Ｄ
Ｇ０１Ｎ　33/53　Ｍ
Ｇ０１Ｎ　33/566

【手続補正書】
【提出日】平成20年2月15日(2008.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　基質を含むインプリント組成物であり、上記基質が着目の高分子の一部に対応する鋳型分子のインプリント孔（inprint cavity）を定める上記インプリント組成物。
【請求項２】　前記基質材が重合体を含む、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項３】　前記重合体が、スチレン、メチル・メタクリレート、２－ヒドロキシエチル・メタクリレート、２－ヒドロキシエチル・アクリレート、メチル・アクリレート、アクリルアミド、ビニル・エーテル、酢酸ビニル、ジビニルベンゼン、エチレン・グリコール・ジメタクリレート、エチレン・グリコール・ジアクリレート、ペンタエリスリトール・ジメタクリレート、ペンタエリスリトール・ジアクリレート、Ｎ，Ｎ′－メチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ′－エチレンビスアクリルアミド、Ｎ，Ｎ′－（１，２－ジヒドロキシエチレン）ビス－アクリルアミド、及びトリメチロールプロパン・トリメタクリレートから成る群から選ばれる重合モノマーを含む、請求項２に記載のインプリント組成物。
【請求項４】　前記基質材が熱感応性化合物を含む、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項５】　前記熱感応性化合物がハイドロゲル、アガロース、ゼラチン、及び成形用プラスチックから成る群から選ばれる、請求項４に記載のインプリント組成物。
【請求項６】　前記鋳型分子が高分子の末端部位に対応する、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項７】　前記高分子がポリヌクレオチドであり、そしてその鋳型分子がオリゴヌクレオチドである、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項８】　前記高分子がポリペプチドであり、そしてその鋳型分子がオリゴ糖である、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項９】　前記高分子がポリペプチドであり、そしてその鋳型分子がペプチドである、請求項１に記載のインプリント組成物。

【請求項１０】　前記ペプチドの配列が前記ポリペプチドの連続配列に対応する、請求項９に記載のインプリント組成物。
【請求項１１】　前記ペプチドが３～３０アミノ酸の長さである、請求項１０に記載のインプリント組成物。
【請求項１２】　前記ペプチドが４～１５アミノ酸の長さである、請求項１０に記載のインプリント組成物。
【請求項１３】　前記ペプチドが４～７アミノ酸の長さである、請求項１０に記載のインプリント組成物。
【請求項１４】　前記ポリペプチドの一部がポリペプチドのＣ末端を含む、請求項１０に記載のインプリント組成物。
【請求項１５】　インプリント孔に結合又は結び付く高分子をさらに含む、請求項１に記載のインプリント組成物。
【請求項１６】　基質を含むインプリント組成物であり、上記基質が複数の鋳型分子の複数のインプリント孔を定め、ここで少なくとも２の鋳型分子が他と異なる上記インプリント組成物。
【請求項１７】　少なくとも１の鋳型分子が着目の高分子の一部に対応する分子である、請求項１６に記載のインプリント組成物。
【請求項１８】　複数の各鋳型分子が他と異なる、請求項１６に記載のインプリント組成物。
【請求項１９】　複数のインプリント孔が空間的に特定可能な柄又は配列に配置される、請求項１６に記載のインプリント組成物。
【請求項２０】　各鋳型分子が３～７アミノ酸の長さのペプチドである、請求項１６に記載のインプリント組成物。
【請求項２１】　請求項１に記載の複数のインプリント組成物。
【請求項２２】　複数の組成物の少なくとも２が他と異なる、請求項２１に記載の複数の組成物。
【請求項２３】　各組成物が少なくとも２の異なる鋳型分子のインプリント孔を定める、請求項２１に記載の複数の組成物。
【請求項２４】　それぞれ異なる鋳型分子が同じ高分子の異なる部分に対応する、請求項２３に記載の複数の組成物。
【請求項２５】　それぞれ異なる鋳型分子が異なる高分子に対応する、請求項２３に記載の複数の組成物。
【請求項２６】　前記組成物が空間的に特定可能な配列又は柄に配置される、請求項２１に記載の複数の組成物。
【請求項２７】　７アミノ酸の長さのペプチドの完全なセットのインプリントを定めるインプリント組成物を含む、請求項２１に記載の複数の組成物。
【請求項２８】　以下のステップ：
（ａ）高分子の一部に対応する鋳型分子の存在下、固体又は半固体形態の時に成形した孔の維持が可能な流動性基質材を凝固させ、その中に取り込んだ鋳型分子を有する固体又は半固体基質材を得；そして
（ｂ）固体又は半固体基質材から鋳型分子を除去し、高分子の捕捉が可能なインプリント組成物を得る、
を含む着目の高分子の捕捉が可能なインプリント組成物の作製方法。
【請求項２９】　前記流動性基質材が熱感応性化合物であり、そして前記凝固ステップが上記熱感応性化合物の温度をその融点以上からその融点以下に下げることを含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】　前記流動性基質材が重合可能な化合物を含む組成物であり、そして前記凝固ステップが上記重合可能な化合物の重合化を含む、請求項２８に記載の方法。
【請求項３１】　前記鋳型分子が固体の支持体又は基材上に固定されている、請求項２８に記載の方法。

【請求項３２】　前記凝固ステップが鋳型分子に関して変性している条件下で実施される、請求項２８に記載の方法。

【請求項３３】　前記凝固ステップが鋳型分子に関して未変性である条件下で実施される、請求項２８に記載の方法。

【請求項３４】　高分子がそのインプリントに結合する条件下、高分子と請求項１に記載のインプリント組成物を接触させることを含む高分子の捕捉方法。

【請求項３５】　以下のステップ：

（ａ）その高分子がそのインプリントに結合する条件下、高分子と請求項１に記載のインプリント組成物と接触させ；そして

（ｂ）上記高分子をインプリントから回収する、

を含む高分子の分離方法。

【請求項３６】　高分子がそれらに対応のインプリント孔に結合する条件下、複数の高分子と空間的に特定可能なインプリント孔の配列と接触させることを含む複数の高分子の捕捉方法であり、ここで鋳型分子の各インプリント孔が複数の中の１つの高分子の一部に対応している上記の方法。

【請求項３７】　以下のステップ：

（ａ）その高分子がそれらに対応のインプリント孔に結合する条件下、サンプルを、鋳型分子の各インプリント孔が複数の内の１の高分子の一部に対応するインプリント孔の空間的に特定可能な配列に接触させ；そして

（ｂ）少なくとも１サブセットの複数のインプリントに結合した高分子の量を定量化する、

を含むサンプル中の複数の異なる高分子の量について定量化する方法。

【請求項３８】　以下のステップ：

（ａ）固定化した鋳型分子の空間的に特定可能な配列の存在下、固体又は半固体を形成した時に成形した孔を維持できる流動性基質材を凝固させ、その中に取り込まれた鋳型分子を有する固体又は半固体基質材を得て；そして

（ｂ）上記固体又は半固体基質材から鋳型分子を除去し、インプリント孔の空間的に特定可能な配列を得る、

を含むインプリント孔の空間的に特定可能な配列の作製方法。

【請求項３９】　少なくとも１の固定化鋳型分子が着目の高分子の一部に対応する、請求項３８に記載の方法。

【請求項４０】　各鋳型分子からの固定化鋳型分子の配列が他と異なる、請求項３８に記載の方法。

【請求項４１】　各固定化鋳型分子が着目の１の高分子の一部に対応する、請求項３８に記載の方法。

【請求項４２】　各固定化鋳型分子が着目の異なる高分子の一部に対応する、請求項３８に記載の方法。

【請求項４３】　複数の内の少なくとも１の高分子が基材を結合する条件下、複数の高分子を請求項１６のインプリント組成物と接触させることを含む複数の高分子の選別方法。

【請求項４４】　複数の内の少なくとも１の高分子が基材に結合する条件下、複数の高分子を請求項２０のインプリント組成物と接触させることを含む複数の高分子の選別方法。